

Thermal process solution provider

半導体洗浄用超音波発生器

High frequency Ultrasonic Cleaning

超音波洗浄のデファクトスタンダード

De facto standard for ultrasonic cleaning

半導体スーパーサイクルを駆抜ける先進の超音波洗浄技術

Advanced Ultrasonic Cleaning Technology to Run Through the Semiconductor Super Cycle

■ 高性能、高信頼性で長期安定稼働

Long-term operation by high function and high reliability

■ 環境配慮の省電力・コンパクト設計

Eco-friendly low power with compact footprint

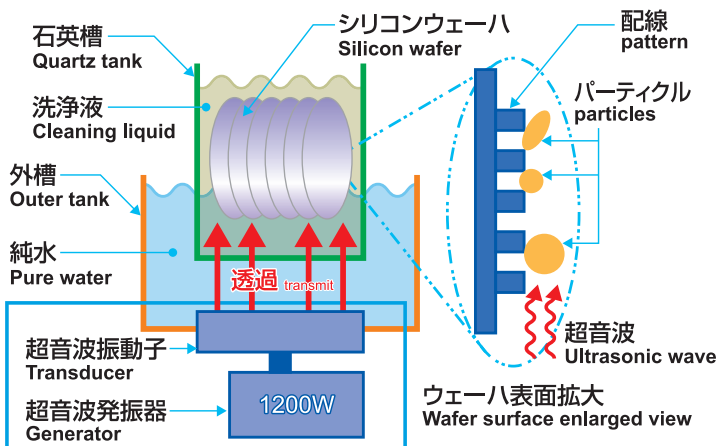
■ 微細かつ均一洗浄で生産性向上

Productivity improvement by fine and uniform cleaning

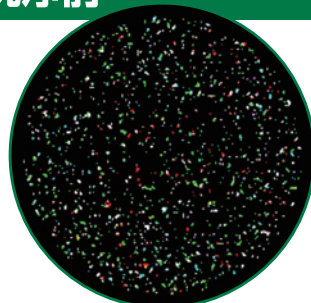
● 半導体ウェーハ用途
Semiconductor wafer

● IoT、最先端デバイス洗浄用途
IoT and other leading-edge devices

半導体ウェーハ洗浄図 Wafer cleaning diagram



洗浄前 Before



洗浄後 After



- ウェーハ : 200mm
Wafer
- 粒子 : Si (≥200nm)
Particle
- 周波数 : 730kHz
Frequency
- 洗浄液 : 超純水
Cleaning liquid Ultra pure water

粒子除去率
Particle removal rate

98%

当社製品 Our product



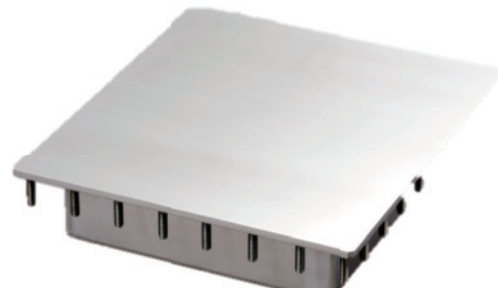
U01200PMCXシリーズ U01200PMCX series

- 微細洗浄用 Generator for High Frequency
- 430kHz、730kHz、1MHz



U01200PDシリーズ U01200PD series

- 強力洗浄用 Generator for Low Frequency
- 26kHz、36kHz、46kHz



外付振動子 Transducer

用途に応じた製品ラインアップを多数取り揃えております
We have Multiple products for your application

※振動子は特注仕様製作致します
※We can produce the transducer with custom specification

現在お使いの洗浄装置を快適にご利用いただくために、最新の洗浄ユニットへのリニューアル(更新)も可能です
We can update your current machine to the latest for comfortable use

国際電気セミコンダクターサービス